Co₂MnGa エピタキシャル薄膜における 異方性磁気抵抗効果の電流方向による符号変化

Sign changes of anisotropic magnetoresistance effect in Co₂MnGa Heusler alloy epitaxial thin films by current direction

豊田中研¹, 静岡大², 東北大³ ⁰佐藤 岳¹, 古門 聡士², 辻川 雅人³ 小川 智之³, 小坂 悟¹, 白井 正文³, 角田 匡清³

Toyota Central R&D Lab., Inc.¹, Shizuoka Univ.², Tohoku Univ.³ [°]Takashi Sato¹, Satoshi Kokado², Masahito Tsujikawa³, Tomoyuki Ogawa³, Satoru Kosaka¹, Masafumi Shirai³, and Masakiyo Tsunoda³ E-mail: t-sato@mosk.tytlabs.co.jp

Co₂MnGa ホイスラー合金は、高スピン分極率および高キュリー点を有するだけでなく、近年、 トポロジカル物性を発現するワイル半金属として注目され、大きな異常ネルンスト効果と異常ホ ール効果が確認されている[1,2]。我々は、Co₂MnGa の異方性磁気抵抗(AMR)効果を検討し、その AMR 比が他のホイスラー合金よりも大きく、5 K で-2.32%、300 K で-0.82%を発現することを明 らかにしている[3]。本研究では、Co₂MnGa エピタキシャル薄膜の AMR 特性について電流方向お よび組成による AMR 比の変化を実験により検討し、第一原理計算による電子状態密度を用いて、 結晶場を考慮した s-d 散乱に基づいた理論式[4]から算出した AMR 比と比較することで、高い負の AMR 比が発現するメカニズムを検討した[5]。

作製した Co₂MnGa 膜への電流方向を Co₂MnGa[110] および[100]とした場合の AMR 曲線を Fig. 1 に示す。 いずれの AMR 曲線も 20成分のみを持ち、Co₂MnGa [110]では負の AMR 比を示す一方で、Co₂MnGa[100]で は正の AMR 比となった。

Fig. 2(a)に、5 K での AMR 比の Co 含有量 x 依存性を 示す。AMR 比は Co₂MnGa[110]では全て負の値であ るが、Co₂MnGa[100]では広く正の値を示し、両者共 に x = 50 at%付近で極大を示した。これらの実験結果 と Fig. 2(b)の AMR 比の計算値を比較すると、電流方 向や Co 含有量による AMR 比の符号および大きさの 変化は良く一致した。すなわち、Co₂MnGa 膜の AMR 比の符号や大きさの変化は、フェルミ準位上での結晶 場分裂した d 軌道の状態密度変化に依存していると 考えられる。

- [1] A. Sakai et al., Nat. Phys. 14, 1119 (2018).
- [2] S. N. Guin et al., NPG Asia Mat. 11, 16 (2019).
- [3] T. Sato et al., Appl. Phys. Lett. 113, 112407 (2018).
- [4] S. Kokado and M. Tsunoda, J. Phys. Soc. Jpn. 88, 034706 (2019).
- [5] T. Sato et al., Appl. Phys. Express 12, 103005 (2019).



Fig. 1 AMR curves of $Co_{49.7}Mn_{22.1}Ga_{28.2}$ film for the electric current direction along $Co_2MnGa[110]$ and [100].



Fig. 2 Changes of (a) AMR ratio measured at 5 K and (b) calculated AMR ratio of $Co_x(Mn_{0.44}Ga_{0.56})_{100-x}$ films for the electric current direction along $Co_2MnGa[110]$ and [100] as a function of *x*.